

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第4区分

【発行日】平成19年6月14日(2007.6.14)

【公表番号】特表2006-522226(P2006-522226A)

【公表日】平成18年9月28日(2006.9.28)

【年通号数】公開・登録公報2006-038

【出願番号】特願2006-509300(P2006-509300)

【国際特許分類】

C 2 5 F 3/24 (2006.01)

C 2 5 F 3/20 (2006.01)

C 2 5 F 3/22 (2006.01)

C 2 5 F 3/26 (2006.01)

C 0 1 B 21/083 (2006.01)

C 0 1 B 7/24 (2006.01)

C 0 1 B 7/20 (2006.01)

【F I】

C 2 5 F 3/24

C 2 5 F 3/20

C 2 5 F 3/22

C 2 5 F 3/26

C 0 1 B 21/083

C 0 1 B 7/24

C 0 1 B 7/20

【手続補正書】

【提出日】平成19年3月26日(2007.3.26)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

反応性化合物を第1の場所から第2の場所まで輸送する間の該反応性化合物の劣化を低減する方法であって、輸送の前に、輸送中の反応性化合物と接触する表面の少なくとも一部を電解研磨するステップを含んでなることを特徴とする方法。

【請求項2】

反応性化合物を第1の場所から第2の場所まで輸送する間の該反応性化合物の劣化を低減する方法であって、反応性化合物の輸送に使われるあらゆる装置の体積に対する内部表面積の比を最小にするステップを含んでなることを特徴とする方法。

【請求項3】

反応性化合物を第1の場所から第2の場所まで輸送する間の該反応性化合物の劣化を低減する方法であって、反応性化合物の輸送に使われるあらゆる装置内のあらゆる死容積を最小または除去するステップを含んでなることを特徴とする方法。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0039

【補正方法】変更

【補正の内容】

【 0 0 3 9 】

表 1 のデータは、輸送中の該 N F 3 に非電解研磨表面がさらされたとき、N F 3 中の望ましくない不純物の形成を示す。

以下に本明細書に記載の発明につき列記する。

1 . 反応性化合物を第 1 の場所から第 2 の場所まで輸送する間の該反応性化合物の劣化を低減する方法であって、輸送の前に、輸送中の反応性化合物と接触する表面の少なくとも一部を電解研磨するステップを含んでなることを特徴とする方法。

2 . 反応性化合物を第 1 の場所から第 2 の場所まで輸送する間の該反応性化合物の劣化を低減する方法であって、反応性化合物の輸送に使われるあらゆる装置の体積に対する内部表面積の比を最小にするステップを含んでなることを特徴とする方法。

3 . 反応性化合物を第 1 の場所から第 2 の場所まで輸送する間の該反応性化合物の劣化を低減する方法であって、反応性化合物の輸送に使われるあらゆる装置内のあらゆる死容積を最小または除去するステップを含んでなることを特徴とする方法。

4 . 前記反応性化合物が、三フッ化窒素、六フッ化タングステン、三フッ化塩素、フッ素、一フッ化塩素、四フッ化二窒素、二フッ化二窒素、テトラフルオロシラン、一酸化フッ素、および三フッ化ホウ素よりなる群から選択されるフッ化反応性ガスであることを特徴とする前記 1 .、2 .、または 3 . のいずれかに記載の方法。

5 . 前記反応性化合物が、三フッ化窒素であることを特徴とする前記 4 . に記載の方法。

6 . 前記第 2 の場所が、分析測定装置であることを特徴とする前記 1 .、2 .、または 3 . のいずれかに記載の方法。

7 . 前記電解研磨した金属表面が、アルミニウム、クロム、コバルト、銅、金、鉄、ニッケル、白金、銀、スズ、チタン、および亜鉛よりなる群から選択される金属を含んでなることを特徴とする前記 1 . に記載の方法。

8 . 前記電解研磨した金属表面が、洋銀、モネル（登録商標）、ハステロイ（登録商標）、インコネル（登録商標）、コパール（登録商標）、低および高炭素鋼、並びにステンレス鋼よりなる群から選択される金属合金を含んでなることを特徴とする前記 1 .、2 .、または 3 . のいずれかに記載の方法。

9 . 前記電解研磨した金属表面が、3 1 6 ステンレス鋼から製造されることを特徴とする前記 1 . に記載の方法。

1 0 . 前記反応性化合物と接触する表面が、加熱されることを特徴とする前記 1 . に記載の方法。

1 1 . 前記反応性化合物の輸送に使われるあらゆる装置の内部表面が、ガス状混合物であるヘリウム中のフッ素で前処理されることを特徴とする前記 1 .、2 .、または 3 . のいずれかに記載の方法。

1 2 . 反応性化合物の輸送に使われるあらゆる装置の体積に対する内部表面積の比を最小にするステップをさらに含んでなることを特徴とする前記 1 . に記載の方法。

1 3 . 反応性化合物の輸送に使われるあらゆる装置内のあらゆる死容積を最小または除去するステップをさらに含んでなることを特徴とする前記 1 . に記載の方法。

1 4 . 反応性化合物の輸送に使われるあらゆる装置内のあらゆる死容積を最小または除去するステップをさらに含んでなることを特徴とする前記 1 2 . に記載の方法。

1 5 . 反応性化合物の輸送に使われるあらゆる装置の体積に対する内部表面積の比を最小にするステップをさらに含んでなることを特徴とする前記 1 3 . に記載の方法。